

株式会社バイ・テクノロジー

第26回定時株主総会

2023年6月27日

第26回定時株主総会

【ご報告事項】

1. 第26期事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

1. 第26期計算書類報告の件

【決議事項】

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 監査役2名選任の件

事業報告

1. 企業集団の現況について (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(1)事業の経過および成果

①事業の概況(1/4)
事業環境

地域

世界経済	<ul style="list-style-type: none">・ 欧米での一部銀行の破綻に端を発した不安定な金融情勢・ インフレ抑制のための金融引き締め
米国	不安定な金融情勢と金融引締めから減速
中国	コロナ関連規制の解除から持ち直しの動き
日本	日米金利差の拡大等から、為替は大きく変動

事業セグメント

FPD	FPD価格の低迷が続く中、設備投資が減少
半導体・ フォトリソ	半導体の市況が一部の用途向けで悪化したものの、当社グループに関連する設備投資は概ね計画通りに推移

(1)事業の経過および成果

①事業の概況(2/4)
当連結会計年度の実績

売上：半導体・フォトマスク装置事業が増収も、パネル価格の低迷からFPD装置事業の売上が低迷し、減収

利益：売上減等の影響から減益

連結業績 (百万円、カッコ内は前々期比)

売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益	受注高	受注残
43,146 (▲8,272)	986 (▲4,475)	1,700 (▲4,168)	260 (▲3,938)	37,072 (▲16,128)	36,647 (▲6,074)

セグメント別 (百万円、カッコ内は前々期比)

セグメント	売上高	営業利益	受注高	受注残
FPD	32,927 (▲9,488)	980 (▲4,121)	20,654 (▲22,129)	21,904 (▲12,273)
半導体・ フォトマスク	9,262 (+623)	254 (▲300)	15,461 (+5,408)	14,742 (+6,199)

(1)事業の経過および成果

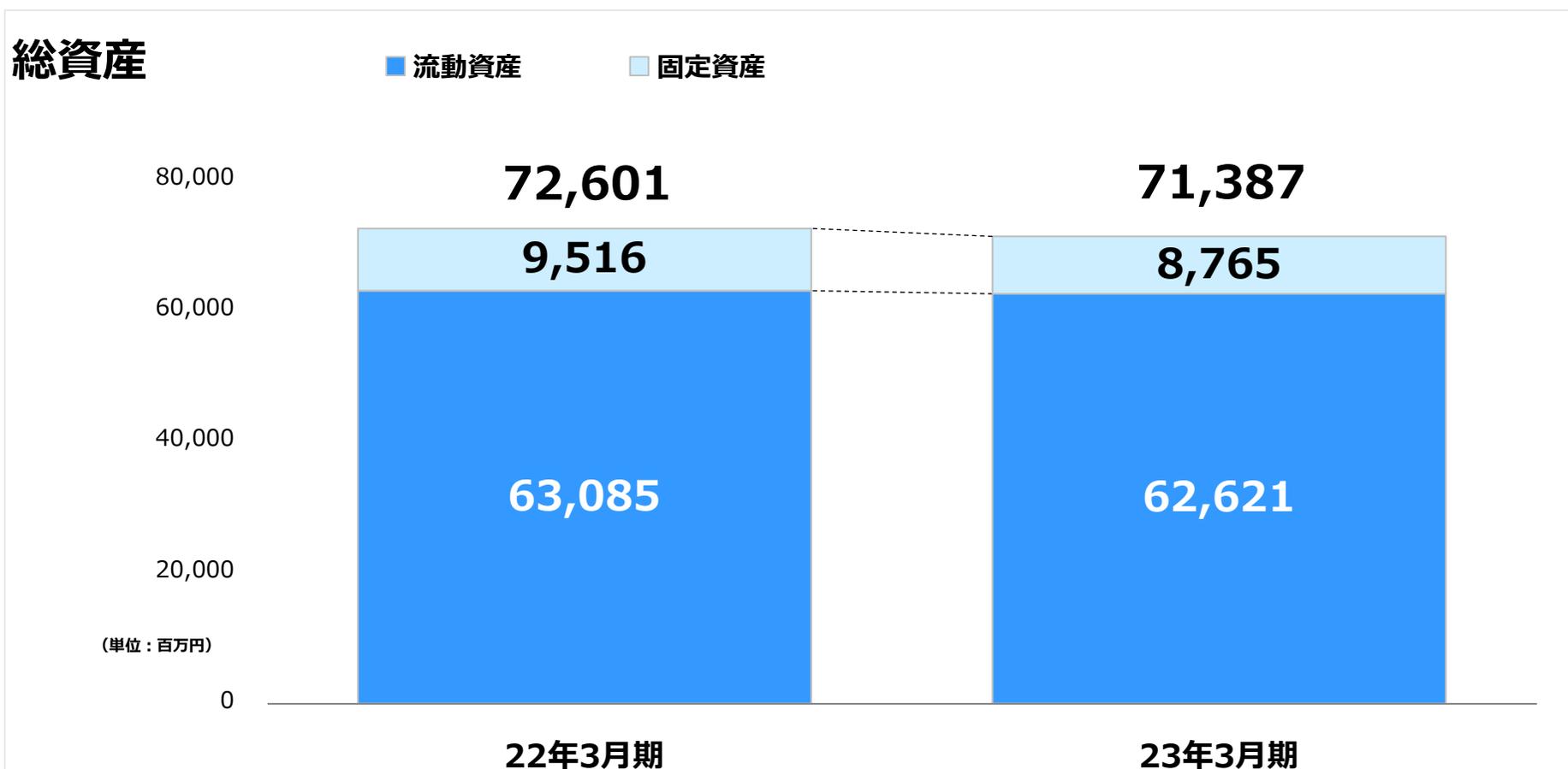
①事業の概況(3/4) 連結貸借対照表

総資産

総資産: 71,387百万円(前期比で1,214百万円減)

流動資産: 「受取手形及び売掛金」等の減少により62,621百万円(前期比464百万円減)

固定資産: 減損等による「機会及び装置」の減少から8,765百万円(前期比751百万円減)



(1)事業の経過および成果

①事業の概況(4/4)
連結貸借対照表

負債・純資産

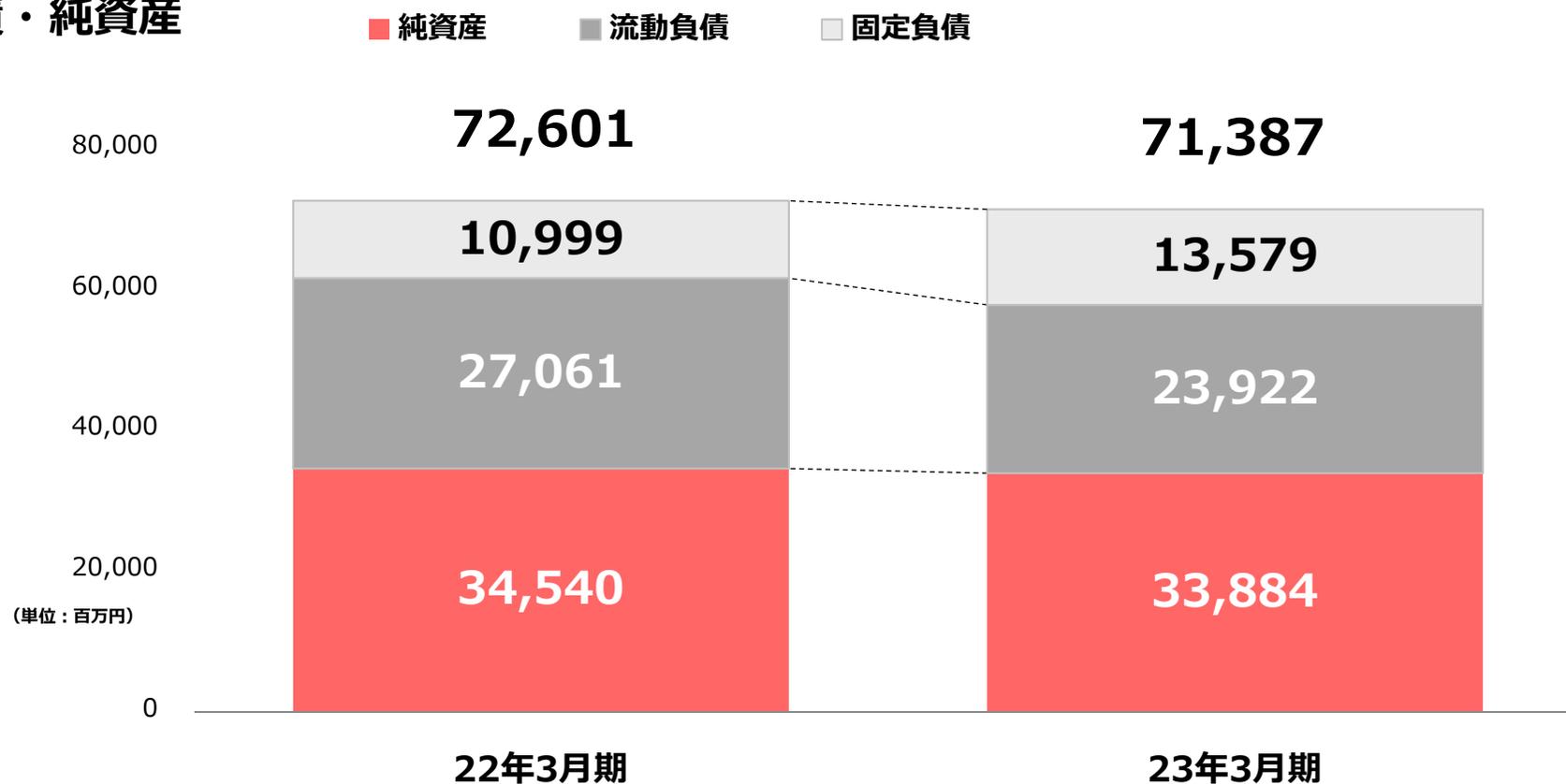
負債: 37,502百万円(前期比558百万円減少)

流動負債: 「電子記録債務」等の減少により23,922百万円(前期3,138百万円減)

固定負債: 「長期借入金」の増加により13,579百万円(前期2,580百万円増)

純資産: 33,884百万円(前期655百万円減少)利益剰余金の減少等による。

負債・純資産



(1)事業の経過および成果

②設備投資の状況

③資金調達の状況

設備投資額：1,007百万円

＞主な用途：横須賀イノベーションセンター新設等

基盤技術開発と半導体関連装置製造の拠点

資金調達：重要な資金調達無し



横須賀イノベーションセンター

(2)重要な事業再編の状況

- ① 2022年5月：株式会社イーエフイーをナノシステムソリューションズの完全子会社とし、シリコンウェハ装置需要増へ対応力を強化
- ② 2023年1月：ジャパンクリエイト株式会社を完全子会社とし、ウェハ製造顧客への製品提案力やグループの真空技術を強化

株式会社イーエフイー

〒206-0033
東京都多摩市落合1-15-2
多摩センタートーセイビル3F

シリコンウェハ検査装置

- ・フィールドエンジニアリング
- ・開発・設計受託



ジャパンクリエイト株式会社

〒359-1167
埼玉県所沢市林1-203-4

ウェットプロセス装置

- ・シリコンウェハ洗浄装置
- ・エッチング装置

真空プロセス装置

- ・CVD装置
- ・スパッタリング装置
- ・蒸着装置
- ・ドライエッチング装置



(3)対処すべき課題

①経営環境

2023年のFPD設備市場は、2012年を下回り過去最低となる見込み*
FPD装置事業の売上は23年を底に、24年からの回復を見込む



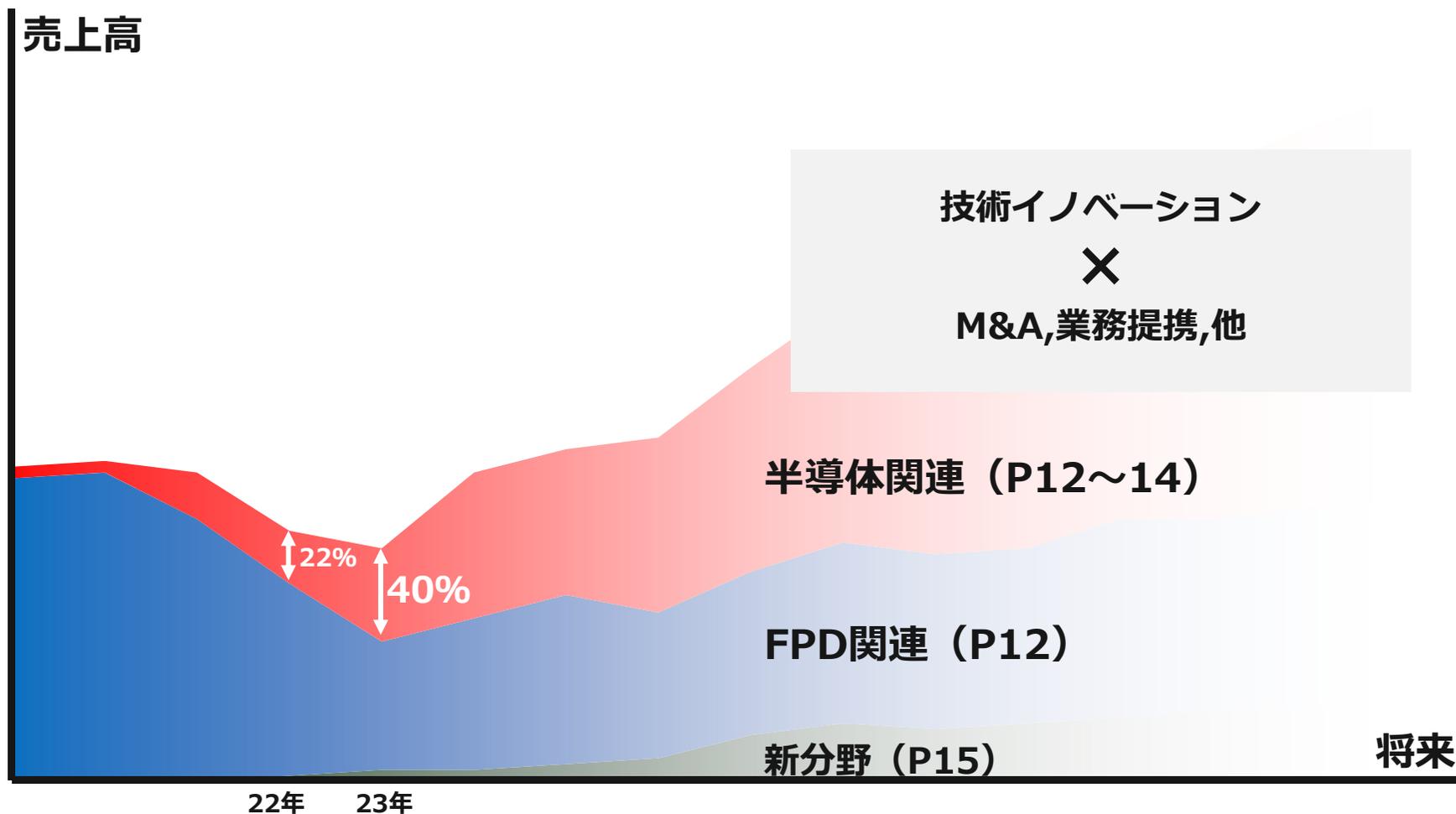
*OMDIA社、DSCC社資料より当社にて推定

(3) 対処すべき課題

② 中長期的な成長に向けた取組み

成長分野へリソースの集中と、FPD装置事業の収益力の強化

- ① 半導体・フォトマスク装置の発展促進
- ② FPD装置事業の収益力強化
- ③ 新分野での事業立上げ(社会課題解決型ビジネスへの挑戦、農業、SiC、他)



(3)対処すべき課題

③主な取組み(1/4)

次世代製造装置の開発

自社開発新製品

半導体フォトマスク用新製品をリリース



Draco
FIB欠陥修正

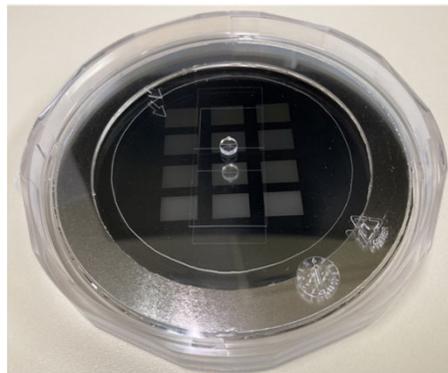


Dione
外観検査



PMARS
座標測定

AR/VR用の超高精細蒸着マスクをリリース



外観写真

電鍍Mask (FMM) の製造開始

VR/AR用途

OLED on Silicon(OLEDoS)等、超高精細小型ディスプレイ製造ライン向け

超高精細、5000ppi超に対応する画素の成膜に成功

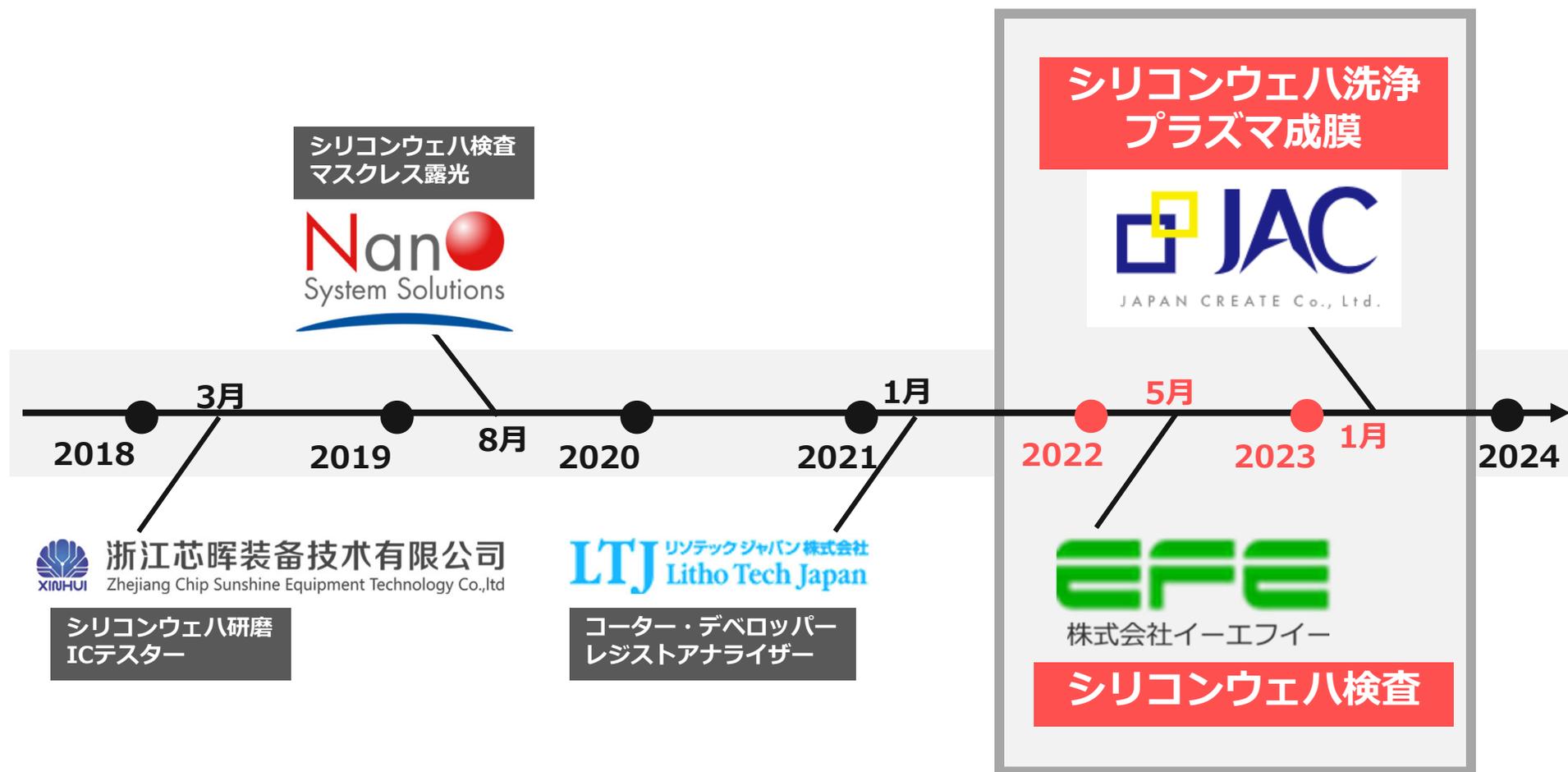
(3)対処すべき課題

③主な取組み(2/4)

半導体分野での取組(M&A関係)

半導体子会社の取得

2022年度：EFE(イーエフイー)、JAC(ジャパングリエイト)
＞ウェハ製造向け製品拡充、フルラインナップ化



(3)対処すべき課題

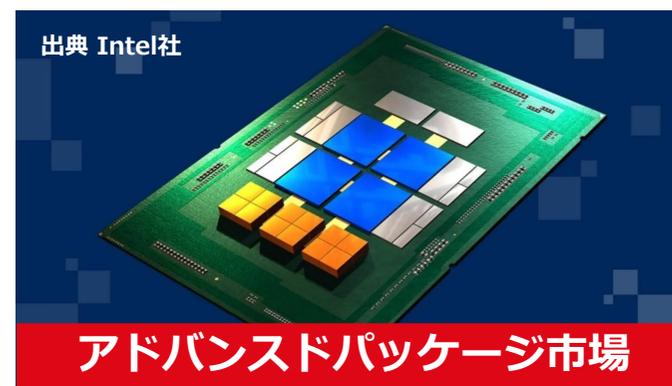
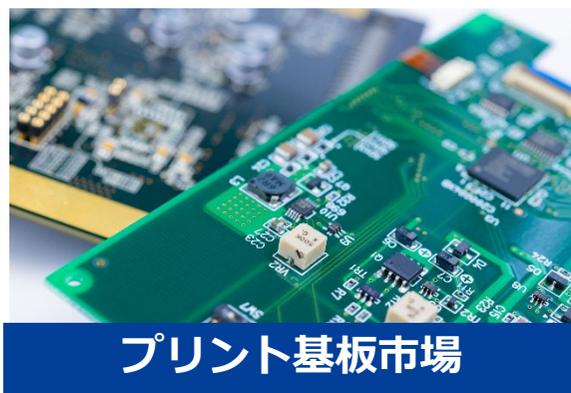
③主な取組み(3/4)

半導体分野での取組(業務提携、他)

PCB分野への参入

LE-TECHNOLOGY設立&CFMEEとの協業、全ユーザー向けにDI*露光販売開始

モジュール
HDI
MLB
FPC
他



*Direct imaging(直描装置)

(3)対処すべき課題

③主な取組み(4/4)

農業分野/脱炭素技術分野での取組

アグリ事業本部の新設

中国および日本（千葉、御殿場、横須賀）にて生産・販売中(EC)

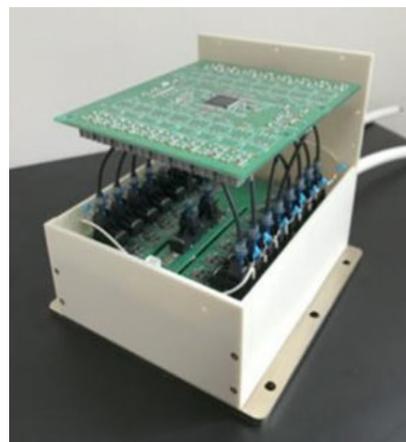


楽天市場URL

ネクスファイ・テクノロジーへの出資

- ・脱炭素技術分野での事業投資
- ・SiC素子を用いた高電圧超高速スイッチングモジュール等の電源技術のベンチャー企業、EV、風力発電、輸送インフラ、半導体製造装置向け

<https://www.nexfi-tech.com/>



耐電圧1 kVクラスのSiCトランジスタを
独自技術により直並列接続し、
10 kVをこえる
高電圧スイッチングモジュールを実現

高電圧スイッチングモジュール

第26期(2023年3月期)の連結業績および来期業績・ 配当予想

売上：半導体・フォトマスク装置事業が伸長も、FPDが大幅に落込み減収

営業利益：前期比微増、FPD装置事業の売上減等の影響

配当：業績状況から、年配当60円を計画

(百万円)	2023年3月期実績		2024年3月期 業績および配当の予想		
	金額	構成比	金額	構成比	前期比
売上高	43,146	100.0%	40,000	100.0%	▲7.3%
営業利益	986	2.3%	1,000	2.5%	+1.4%
経常利益	1,700	3.9%	850	2.1%	▲50.0%
親会社株主に 帰属する当期純利益	260	0.6%	550	1.4%	+111.3%
EPS(円)	26.92		56.88		—
配当(円)	中間	60円(実績)	30円		▲30円
	期末	30円(予定)	30円		—

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の事業の拡大や経営基盤強化の為に必要な内部留保の充実を図りつつ、配当の安定性・継続性を考慮の上、経営成績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。

上記基本方針および当期業績等を勘案し、期末配当金を下記の通りとさせていただきます。

第26期 期末配当金：1株につき金30円

効力が生じる日（支払日）：2023年6月28日（水）

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役中原有庸氏及び大倉修和氏の2名は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)
1	なかはら ありつね 中原 有庸 (1962年3月8日)
2 新任/社外/独立	あびる おさむ 阿比留 修 (1955年4月9日)

**株式会社バイ・テクノロジー
第26回定時株主総会にご出席頂き、
ありがとうございました。**